## 大口径電子ビームのカスプ磁場への入射と

# それに伴うプラズマの変化の観測

# 安藤 利得、遊津 元希、壬生 健太(金沢大学 数物科学系) 佐藤 杉弥(日本工業大学 共通教育系) 谷川 隆夫(東海大学 総合科学技術研究所) 山際 啓一郎(静岡大学 名誉教授)

1. はじめに

カスプ磁場は太陽磁場や地球磁場等に存在し、恒星間プラズマと地球磁気圏を連結する要の役 割をする。地球周辺のスペースの環境を左右する重要な要素の1つであることから、その性質を正 確に理解する必要がある。カスプの論文には例えば文献[1]があるが、さらに研究を進めることが必 要であると考えている。

2. カスプ磁場の形成

本実験に用いる JAXA の 高密度磁化プラズマ発生装置(Large Helicon Plasma Device, LHPD) の概略図を図1に示す。全長約5mの直線状磁場閉じ込め装置である。左端におかれたフラットスパ イラルアンテナを用いることによって、ヘリコン波を用いた大容量で高密度なプラズマ生成が可能 な装置である。アンテナの手前に補助磁場コイルが設置されており、チャンバーとアンテナのあい だで磁場が弱くなるのを防ぐことができる。主コイルの直径は約0.935m、補助コイルの直径は約 1.03mである。本研究ではこれを活用する。

補助コイルには主磁場とは独立に電流が流せるため、磁場の向きを反転させることによって、



図1 LHPD 装置と磁場コイルの配置

カスプ磁場を形成することができる。また、電流値を変化させることにより、カスプの位置を移動 させることができる。

図2 に真空容器の端での磁場強度分布の計算値を示す。Z軸の原点はアンテナが外側から接す るクウォーツガラスの真空側にとる。図中にコイルの位置は点線で示されている。主磁場に流す電 流を 50Aに一定にして、補助コイル流す電流を変化させた。10Aおきに 0Aから-50Aまで変えた 際に予想されるチャンバー の中心軸上での磁場の強度 分布を示す。

電磁場強度が零になる セパラトリクスの位置は電 流値を負に大きくするのに 伴ないZ=0mから0.45mま で変えられる。図1に示され ているようにZ=0.35mの ところに直径約30cmのガ ラス窓の観測ポートがあり、 カスプの側面からの観測に 用いることができる。また、 プラズマの生成用のアンテ ナを取り除けば、正面から観 測が可能である。

### 新たな電子銃

カスプ磁場中での電子ビームの 軌道を観察するために小型の電子銃 が必要とされた。平成23年度までに 我々は大口径電子ビーム源(カソー ド直径 φ 120 mm) を開発している [2-5]が、本目的には合わない。そこ で、新たに小型の電子銃を2つ設計、 製作することにした。電子ビームの 一様性を確保するために、これまで 通り、カソードは傍熱型で、電子放 射物質としてバリウムの酸化物を採 用した。カソードの直径は それぞれ ソードはニッケル製の円筒型であり、 ケーキ型である。設計上の注意点は 電子放出体である酸化物は一度空気 に触れさせてしまうと使えなくなっ てしまうことから、カソードが再利 用できるようにいずれも分解して、 塗り直し、再度組み立てができるよ うにした点である。また、カソード からの熱輻射を防ぐために反射板を 数枚設置した。いずれもこれまで、 静岡大および大口径電子ビーム源で 養った技術を使っている[6]。

便宜的にφ5を「小型」、φ20を「中 型」、これまでのφ120を「大型」と



図 2 LHPD の中心軸上の磁場分布。主コイルの電流を 50A に一定 にして、補助コイルの電流を 0A から−50A まで 10A 刻みで変えた。 B z =0G の位置を図中に○で示した。



図3  $\phi 20mm$  電子銃と $\phi 5mm$  電子銃

呼ぶことにする。以下の表にそれぞれの電子ビーム源のパラメータを載せる。

表1 電子銃の比較。消費電力はヒーターの電流と電圧を計測して算出した。ビーム電流はKとCG から放出される電流を測定した。最後に電子ビーム源を活性化するのに必要とした時間を示した。 ()の中の値は小型を1とした値である。

タイプ	カソード 直径	カソード 面積	外寸	消費電力	電流 x 電圧	ビーム電流	活性化
	(mm)	(cm2)	(mm)	(W)	(A) x (V)	mA(A-K 電圧)	(hours)
大型	120	113 (144)	φ156 x 100	324 (46)	27 x 12	300(40V 時) (2000)	11 (2.8)
中型	20	3.1 (4)	φ42 x 70	30 (4)	6.5 x 4.2	9.7(60V時) (64)	5 (1.3)
小型	5	0.785 (1)	φ16 x 70	7 (1)	2 x 3.5	0.15(10V時) (1)	4 (1)

大型はカソード(K)とアノードグリッド(A) の外に電流量を調節するコントロールグリッド (CG)を備えた3極型であり、今回作った電子 銃はいずれも2極型である。

活性化は10<sup>-4</sup> Paのオーダーの真空を保持 しながら行なった。活性化の時間は排気速度に 依るところが大きいので上記の値はあくまで目 安である。表1で分かるように活性化に必要な 時間は、大型と比べ、小型と中型が少ない。ま た、カソードを動作させるためのヒーターの消 費電力も小さい。そのため、かなり手軽に使う ことができる。

#### 4. カスプ磁場と電子ビームの観測

電子ビーム自体は光らないが薄いアルゴ ンガスを入れるとアルゴン原子がビーム電子 により励起され光を発するために目視が可能 となる。カスプ磁場部に電子ビームを入射し た際の写真を図4に示す。主磁場を70 Gauss、 補助コイルに-15Aを流し、アルゴンガスを 1.7×10<sup>-2</sup> Pa で満たし、70Vで電子ビームを 加速している。 左側が真空チャンバーの中央 で、右側がチャンバーの端となっている。写 真は Z = 0.35mの観測ポートからで数秒の 露出時間を掛けて撮っている。2つの電子ビ ームを同時に入射している。 φ 20 の電子銃は 写真の左端よりさらに左側に置かれており写 真には映っていない。 きれいなスピンドルカ スプの形が見え、 φ 20 の電子ビームによって カスプ磁場のおおよそを視覚化できているの がわかる。また、もう一つの 65 電子銃は写



図4 カスプ磁場と電子ビーム。左側から2種類の電子ビームを入射している。 φ20 のビーム はカスプ全体に広がり、φ5 はそれほど広がって いないのがわかる。



真中の e-gun と示した所にあり、そこから、細い電子ビームが出ているのが映っている。φ5 電子ビームは、磁力線に巻きつくようにらせん状に軌道を描いており、磁力線をおおよそ把握することができる。

また、図5にφ20電子ビームの入射位置を真空チャンバーの中心軸より3cm下方にずらした時の様子を示す。この場合には電子ビームのほとんどは磁場によって下方に曲げられる。図4の場合には電子ビームが中心に入射されるため、大多数の電子がカスプ面を抜けて反対側に行けるが、図5の場合にはカスプ面を通り抜けられない。そのため、左右の明るさが大きく異なり、左右を分ける境界面をはっきり目視できる。

#### 5. まとめ

高密度プラズマ発生装置(LHPD)は、真空チャンバー端で補助磁場コイルを備えており、これを 用いて カスプ磁場を作ることができることを示した。新たに2つの電子銃(中型: φ20mmと小型: φ5mm)を設計、製作し、これまでの大口径電子銃(大型: φ120mm)と性能の比較をした。新 しい電子銃はカソードの活性化の時間が短く、実験の省力化ができる。大型と中型はカスプ磁場を 照射し磁場の全体像を可視化することができる。小型からのビームは直径が細いため、カスプ磁場 による広がりが少なく、磁力線に沿って軌道を描くがわかった。これらを有機的に組み合わせて、 今後カスプの観測に用いてゆく。

#### 謝辞

本実験を遂行するにあたり、JAXAの阿部琢美先生には多大なご支援をして頂きました。ここに 深くお礼申し上げる次第です。スペース・プラズマ共同研究設備の山本技官には実験を実施するに あたり大変お世話になりました。お礼申し上げます。

## 参考文献

- 1. "カスプ磁場におけるプラズマ",大林,佐藤,鳥羽,渡辺,高山, IPPJ-REV5, 231-242, 1989-03.
- 2. "新型大口径電子ビーム源を使用した電子ビーム・プラズマ不安定性の実験Ⅱ",谷川,安藤, 遊津,佐藤,山際,「スペース・プラズマ研究会 平成23年度」講演集,25,(2012.3).
- 3. "新型大口径電子ビーム源を使用した電子ビーム・プラズマ不安定性の実験",安藤,遊津,谷川,佐藤,山際,「スペース・プラズマ研究会 平成 22 年度」講演集,20, (2011.3).
- "電子ビーム・プラズマ系における非線形現象実験用の大口径電子ビーム源の製作と性能試験 II",谷川,安藤,佐藤,山際,「スペース・プラズマ研究会 平成21年度」論文集,pp. 37-1-37-4 (2010).
- 5. "電子ビーム・プラズマ系における非線形現象実験用の大口径電子ビーム源の製作と性能試験", 谷川,安藤,干場,佐藤,山際,「スペース・プラズマ研究会 平成20年度」論文集,pp. 66 -69 (2009).
- T. Takeda and K. Yamagiwa, Phys. Lett. A **339**, 118 (2005); J. Plasma Fusion Res. **79**, 323 (2003); J. Plasma Fusion Res. SERIES **6**, 566 (2004).